

Ion beam mixing과 급속열처리 방법을 이용한 Ti-SALICIDE용 TiSi₂ 박막 개선에 관한 연구

최병선, 구경완, 천희곤, 조동율

울산대학교 재료공학과 울산 680-749

**Ion beam mixing과 질소분위기에서의 Rapid Thermal Annealing(RTA)을 이용하여
TiSi₂ 박막의 표면과 계면의 물리적, 전기적 특성이 크게 개선되었으며 기존
Ti-SALICIDE의 신뢰도 측면에서 문제가 될 수 있는 Oxide Spacer상에서의 Lateral
Silicide 형성이 최대한 억제될 수 있었다. 또, Ti-SALICIDE 공정에서의 Ti/Si와
Ti/SiO₂의 Interaction을 반응조건별로 연구하였다.**

* 이 논문은 1990년도 교육부 학술연구조성비에 의하여 연구되었음.